

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-099165

(43)Date of publication of application : 11.04.1995

(51)Int.Cl.

H01L 21/22
H01L 21/205
H01L 21/31
H01L 21/324

(21)Application number : 06-155356

(71)Applicant : TOKYO ELECTRON LTD
TOKYO ELECTRON TOHOKU LTD

(22)Date of filing : 14.06.1994

(72)Inventor : OKASE WATARU

(30)Priority

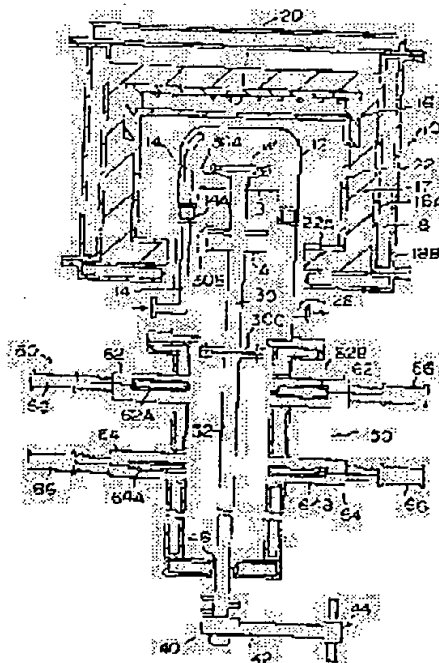
Priority number : 05172674 Priority date : 18.06.1993 Priority country : JP

(54) HEAT TREATMENT APPARATUS

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a heat treatment apparatus wherein the whole face of an object to be treated can be heat-treated with good efficiency at a uniform temperature and a throughput can be enhanced in a manufacturing process.

CONSTITUTION: A soaking member 22 is arranged at least on the surface side and the rear side of an object W, to be treated, which is arranged in a treatment position. The soaking member 22 is heated by radiant heat from a facelike heat-generating source 20, it radiates secondary radiant heat, and the object W to be heated is heated uniformly. Especially, a soaking member 22A on the rear side heats the peripheral edge part of the object W, to be treated, which dissipates much heat, from its rear side. The uniformity inside the face of the treatment temperature of the object W to be treated is improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 05.06.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

公開特許公報フロントページ

(11)公開番号：特開平07-099165

(43)公開日： 1995年04月11日

(51)Int.Cl.6

H01L 21/22 511

21/205

21/31

21/324

(21)出願番号：特願平06-155356

(71)出願人： 東京エレクトロン株式会社
東京エレクトロン東北株式会社

(22)出願日： 1994年06月14日

(72)発明者： 大加瀬 亘

(30)優先権

優先権主張番号：1993172674

優先日：1993年06月18日

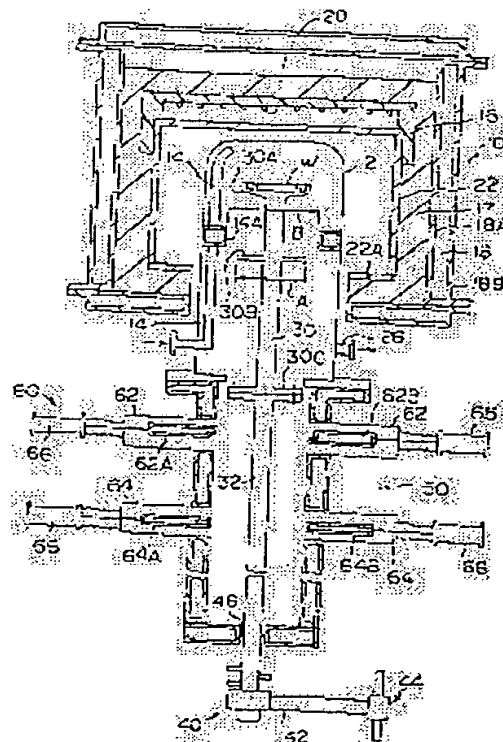
優先権主張国：JP

(54) 熱処理装置

(57)【要約】

【目的】被処理体の全面を均一な温度で効率良く熱処理することができると共に製造工程でのスループットを向上させる熱処理装置を提供することにある。

【構成】処理位置に配置された被処理体Wの少なくとも表面側および裏面側に均熱部材22を配置している。この均熱部材22は、面状発熱源20からの輻射熱により加熱され、二次輻射熱を放射して被処理体Wを均一に加熱する。特に、裏面側の均熱部材22Aは、放熱の多い被処理体Wの周縁部を、その裏面側より加熱して、被処理体Wの処理温度の面内均一性を改善する。



リーガルステータス

【審査請求日】

2001年06月05日

【拒絶査定発送日】

【最終処分種別】

【最終処分日】

【特許番号】

【登録日】

【拒絶査定不服審判番号】

【拒絶査定不服審判請求日】

【本権利消滅日】

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office